

# STUDIUM INTERAKCE FOKUSOVANÉHO SVAZKU XUV KAPILÁRNÍHO LASERU S PEVNOU LÁTKOU

## NEVRATNÉ POŠKOZENÍ A IONTOVÁ EMISE

Autor: **Bc. Jakub Bulička**

Vedoucí úkolu: **Ing. Libor Juha, CSc.**

Konzultant: **Ing. Luděk Vyšín, PhD.**



## ① TEORETICKÁ ČÁST VÚ

Fokusace XUV svazků

Charakterizace XUV svazků

## ② EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST VÚ

Kapilární výbojový XUV laser

Hmotnostní spektroskopie využívající XUV CDL

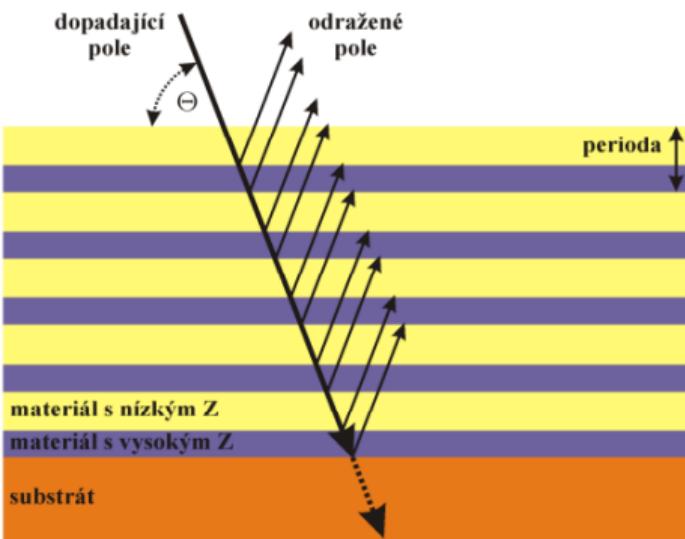
Data z XUV CDL TOF MS měření

# FOKUSACE XUV SVAZKŮ I - MNOHOVRSTVÉ ZRCADLO

## BRAGGOVA DIFRAKČNÍ PODMÍNKA

$$m\lambda = 2d \sin \theta$$

- $\sim 10$  vrstev
- Velký rozdíl  $n \Rightarrow$  odraz
- Pro XUV/měkké RTG ( $< 1$  keV)
- Mo/Si, Sc/Si, W/C, Mo/Be



**OBR.:** Struktura mnohovrstvého zrcadla.

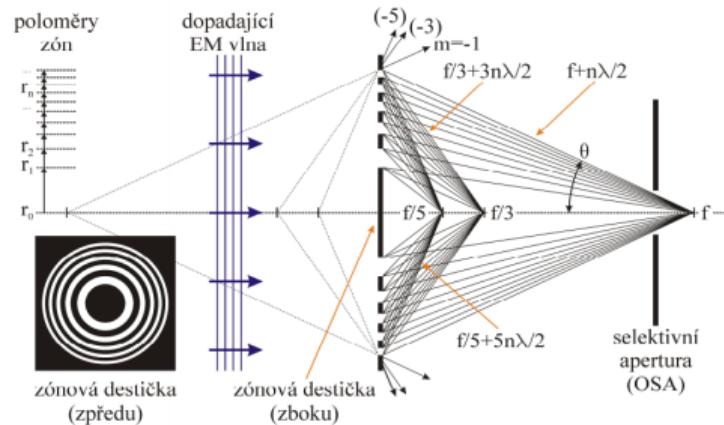
Zdroj: J. Chalupský: *Charakterizace svazků rentgenových laserů různých typů*. 2012. Dis. práce.

# FOKUSACE XUV SVAZKŮ II - ZÓNOVÁ DESTIČKA

## POLOMĚR N-TÉ ZÓNY ( $r_n$ )

$$f^2 + r_n^2 = (f + n\lambda/2)^2 \Rightarrow r_n \approx \sqrt{n\lambda f}$$

- Konstruktivní interference vln se stejným znaménkem
- Ohnisková vzdálenost je funkcí  $\lambda$
- Ztráty v záporných zónách



**OBR.:** Princip binární zónové destičky.

Zdroj: J. Chalupský: Charakterizace svazků rentgenových laserů různých typů. 2012. Dis. práce.

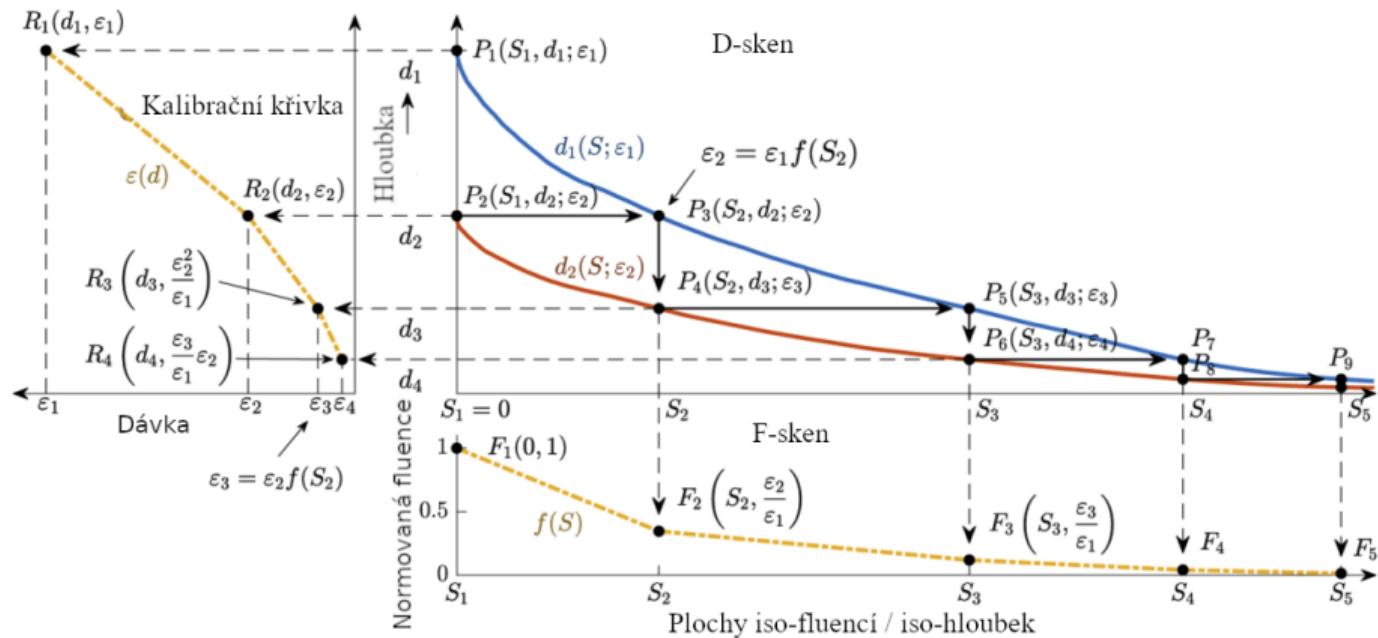
## Přímé metody

- ① Luminiscenční detektory
- ② Metody ablačních a desorpčních imprintů

## Nepřímé metody

- ① Rentgenové CCD kamery
- ② Hartmanův senzor

# METODA ABLAČNÍCH IMPRINTŮ

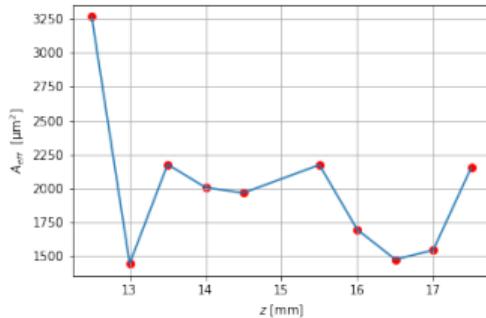
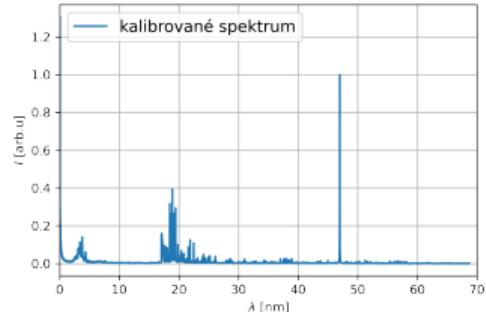
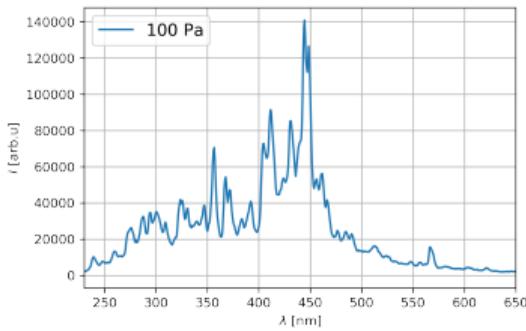


OBR.: Schéma NoReFry algoritmu.

Zdroj: V. Vozda a kol.: *Characterization of megahertz X-ray laser beams by multishot desorption imprints in PMMA*. Optics Express, **28**, 25664 (2020).

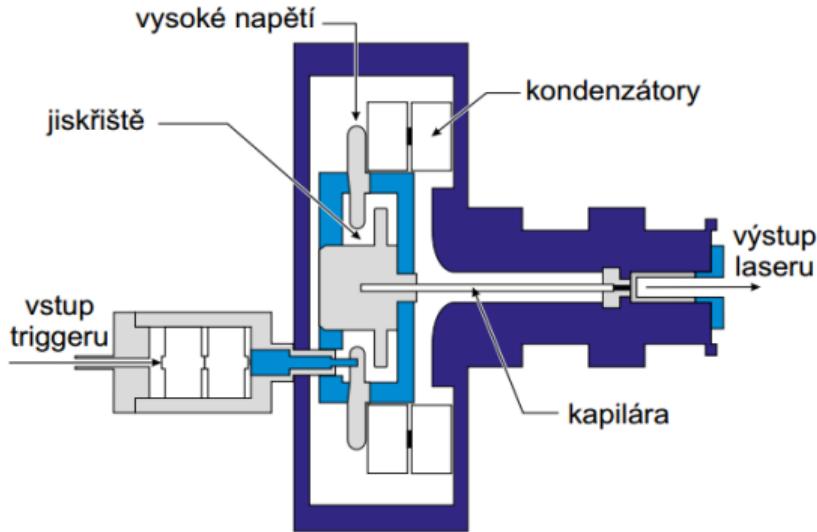
# EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST VÚ

- Navazuje na experimentální část BP
- Hlavní výstup - posoudit vliv interakčních podmínek na nevratné změny a iontovou emisi vyvolané XUV zářením.



**OBR.:** UV-Vis spektrum (vlevo), spektrum krátkovlnného záření (veprostřed) a kaustická křivka (vpravo) pro XUV CDL.

# KAPILÁRNÍ VÝBOJOVÝ XUV LASER (XUV CDL)



**OBR.:** Schéma laserové hlavy kompaktního repetičního kapilárního výbojového XUV laseru (vlevo) a kompletní sestava CDL.

Zdroj: J. Chalupský a kol.: *Fokusovaný svazek repetičního kapilárního laseru na 46,9 nm*. Čs. čas. fyz. **58**, 234 (2008).

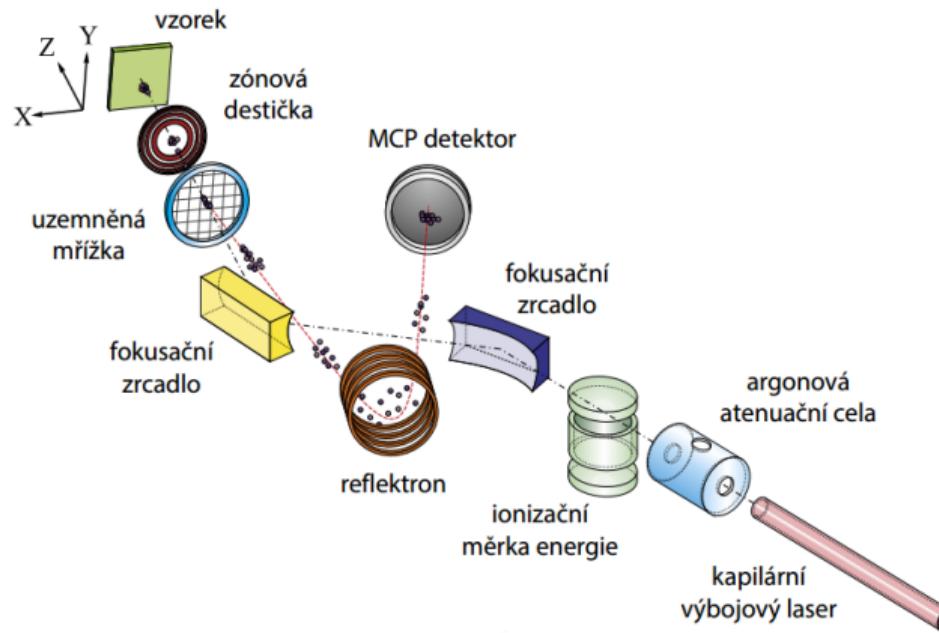
# PARAMETRY XUV CDL

Rozměry	$0,4 \times 0,4 \text{ m}^2$ ( $0,4 \times 0,8 \text{ m}^2$ včetně TM)
Hmotnost	400 kg
Vlnová délka	46,9 nm
Délka pulzu	1,5 ns (FWHM)
Energie pulzu	$> 10 \mu\text{J}$
Opakovací frekvence	5 Hz (běžně); 12 Hz (max)
Životnost kapiláry	$(2 - 3) \times 10^4$ pulzů
Proud	$\sim 21 \text{ kA}$
Kapilára	$\text{Al}_2\text{O}_3$ ( $d = 3,2 \text{ mm}$ , $l = 210 \text{ mm}$ )

**TABLE:** Parametry CDL. TM - turbomolekulární (vývěva), FWHM - (délka pulzu) v polovině maximální intenzity,  $d$  - vnitřní průměr (kapiláry),  $l$  - délka (kapiláry).

Zdroj: L. Vyšín a kol.: *Characterization of focused beam of desktop 10Hz capillary-discharge 46.9-nm laser.*  
Proc. SPIE **7361**, Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II, 736100 (2009)

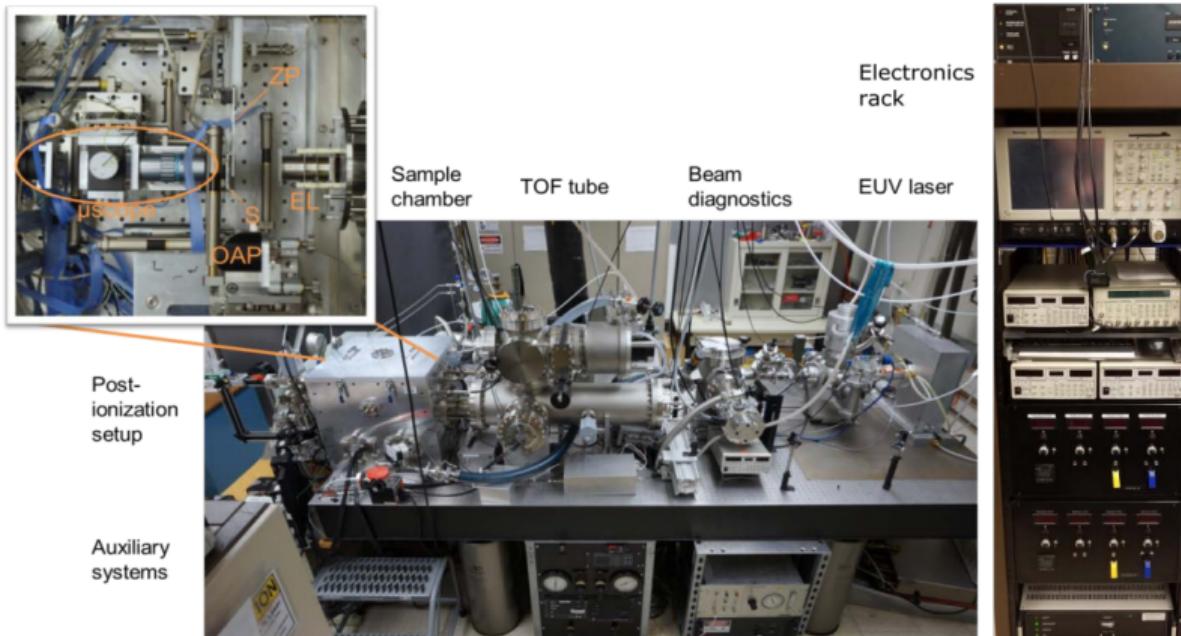
# HMOTNOSTNÍ SPEKTROSKOPIE VYUŽÍVAJÍCÍ XUV CDL



**OBR.:** Schéma aparatury pro XUV CDL TOF MS měření.

Zdroj: T. Burian a kol.: *Hmotová spektrometrická mikroskopie využívající ablaci XUV laserem*. Čs. čas. fyz. **65**, 259 (2015).

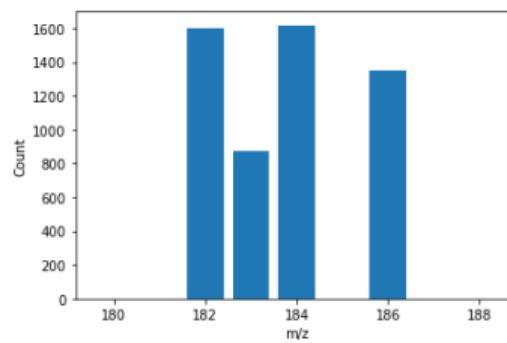
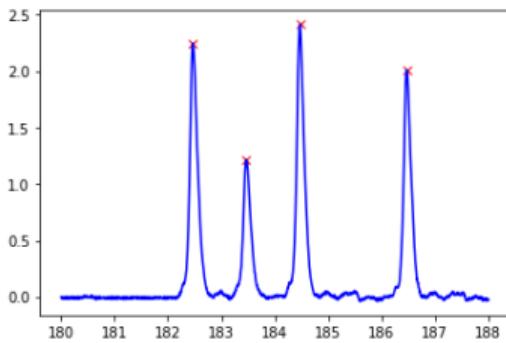
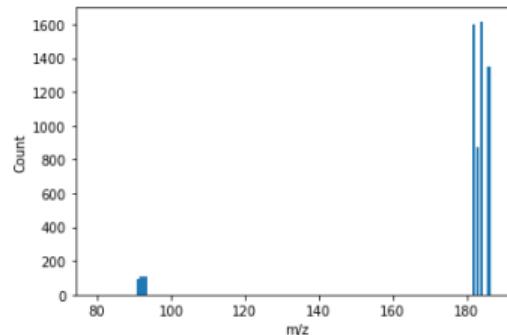
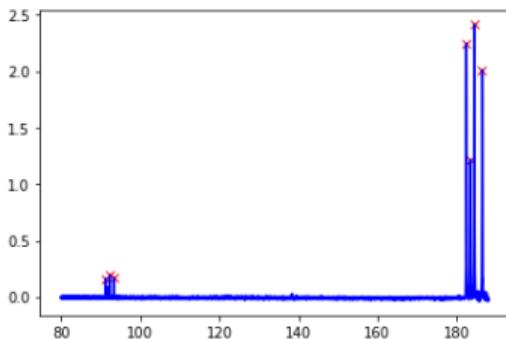
# HMOTNOSTNÍ SPEKTROSKOPIE VYUŽÍVAJÍCÍ XUV CDL



**OBR.:** Aparatura pro XUV CDL TOF MS měření.

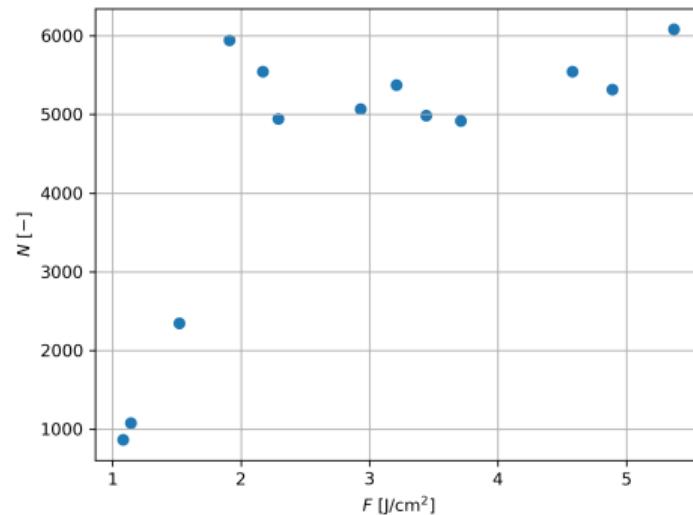
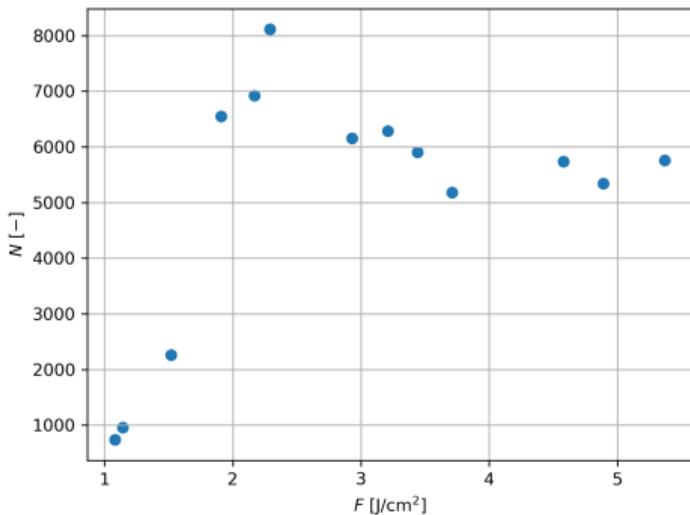
Zdroj: I. Kuznetsov: *Extreme Ultraviolet Laser Ablation Mass Spectrometer for Molecular Imaging at the Nanoscale*. 2018. Dis. práce.

# DATA Z XUV CDL TOF MS MĚŘENÍ I



**OBR.:** Hmotnostní spektra a histogramy pro wolfram (bez atenuace).

# DATA Z XUV CDL TOF MS MĚŘENÍ II



**OBR.:** Závislost fluenze  $F$  na četnosti  $N$  pro wolfram (průměr vrstev 2 a 3 (vlevo) a vrstva 3 samostatně).

- Byla proměřena iontová emise z W, W+Cr, PMMA a dalších
- Dokončit rekonstrukci CDL na FZU
- Proměřit průběh energie svazku XUV CDL

# REFERENCE I

- **Rentgenová optika**
  - J. Chalupský: *Charakterizace svazků rentgenových laserů různých typů*. Praha, 2012. Disertační práce. ČVUT FJFI KFE, školitel: Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc., školitel-specialista: Ing. Libor Juha, CSc.
  - J. Chalupský a kol.: *Comparing different approaches to characterization of focused X-ray laser beams*. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A **631**, 130 (2011).
- **Kompaktní repetiční XUV CDL**
  - J. Chalupský a kol.: *Fokusovaný svazek repetičního kapilárního laseru na 46,9 nm*. Čs. čas. fyz. **58**, 234 (2008).
  - S. Heinbuch a kol.: *Demonstration of a desk-top size high repetition rate soft x-ray laser*. Opt. Express **13**, 4050 (2005).
  - L. Vyšin a kol.: *Characterization of focused beam of desktop 10Hz capillary-discharge 46.9-nm laser*. Proc. SPIE **7361**, Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II, 736100 (2009).

- **Hmotová spektrometrie využívající XUV CDL**

- T. Burian a kol.: *Hmotová spektrometrická mikroskopie využívající ablaci XUV laserem.* Čs. čas. fyz. **65**, 259 (2015).
- I. Kuznetsov a kol.: *Three-dimensional nanoscale molecular imaging by extreme ultraviolet laser ablation mass spectrometry.* Nat. Commun. **6**, 6944 (2015).
- I. Kuznetsov: *Extreme Ultraviolet Laser Ablation Mass Spectrometer for Molecular Imaging at the Nanoscale.* Fort Collins, Colorado, 2018. Disertační práce. CSU Departement of Electrical and Computer Engineering. Advisor: Carmen Menoni.

Děkuji za pozornost.